

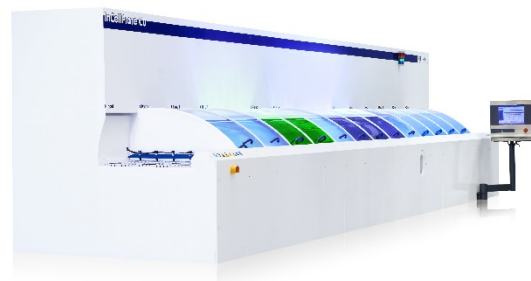
## RENA Technologies wird auf der SNEC 2018 für eine zukunftsweisende Metallisierungstechnologie ausgezeichnet und stellt eine Weiterentwicklung von RENA BatchTex vor

**Gütenbach, 25. Juni 2018.** Die RENA Technologies GmbH (Deutschland) wurde am 30. Mai 2018 auf der Shanghai New Energy Conference (SNEC) für ihre neue Generation der Metallisierungstechnologie, RENA InCellPlate, mit dem Terawatt Diamond Award gewürdigt. Im Rahmen der „SNEC 2018 Top 10 Highlights“ wurde die neuartige und kostensparende Metallisierungslösung von RENA mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Der Award wurde von Prof. Martin Green von der University of New South Wales, Australien, präsentiert und übergeben.

Peter Schneidewind, CEO der RENA Technologies GmbH, erklärt dazu: „Wir sind sehr stolz auf diese bedeutende Auszeichnung für unsere InCellPlate-Technologie. Wir sorgen dafür, dass Zellenhersteller den nächsten großen Schritt in der Metallisierung von Solarzellen gehen können, denn unsere Lösung ermöglicht massive Kosteneinsparungen und gleichzeitig eine höhere Zelleneffizienz. Dies ist von größter Bedeutung, um die Kosten der Solarenergie senken zu können.“ Dank der InCellPlate-Technologie von RENA gehört das kostenintensive Siebdruckverfahren für die Aufbringung von Silber-Elektroden auf der Vorderseite der Zellen der Vergangenheit an, denn bei dieser neuen Technologie werden Stapel bestehend aus Nickel (Ni), Kupfer (Cu) und einer dünnen Abdeckschicht Silber (Ag) per Galvanisierung aufgebracht. „Mehr als 0,04 USD/Zelle können so bei der Herstellung der Zellen eingespart werden. Damit wird eine Kostensenkung von mehr als 20 % bei der Metallisierung erreicht“, schließt Peter Schneidewind.



RENA wurde auf der SNEC 2018 für ihre InCellPlate-Technologie mit dem Terawatt Diamond Award ausgezeichnet.

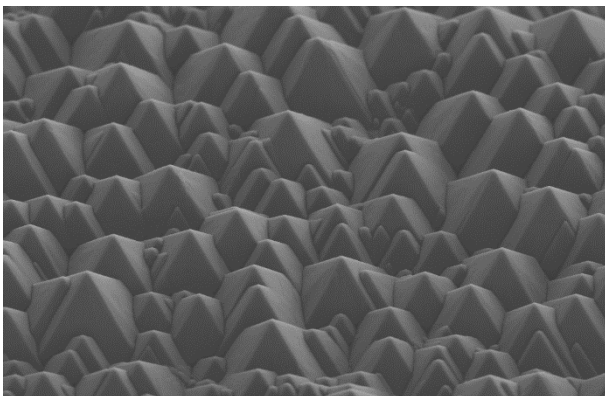


RENA InCellPlate Cu: Anlage für die nasschemische Abscheidung von Nickel, Kupfer und Silber anstelle des kostenintensiven Silber-Siebdrucks

RENA präsentierte auf der SNEC 2018 in Shanghai außerdem die neue Generation ihrer BatchTex-Technologie, die auf der Intersolar 2018 in München weiter vorgestellt wurde. Mit RENA BatchTex N400-8000 kann dank der neuen Generation des RENA monoTEX®-Prozesses ein Durchsatz von bis zu 8000 Wafern/Stunde erreicht werden. Dies entspricht einem Anstieg von 30 % im Vergleich zum aktuellen Volumen. Gleichzeitig können die Betriebskosten für die alkalische Texturierung deutlich reduziert werden.

„Wir haben die Produktivität unserer BatchTex-Technologie auf eine ganz neue Ebene gebracht:

Durch den Einsatz von „RENA monoTEX G“, eines neuartigen Additivs für die alkalische Texturierung, können wir eine 30%ige Steigerung der Waferproduktion bei konstanter Anlagengröße erreichen. Damit lassen sich die Kosten pro Wafer reduzieren, d. h. wir können unsere Kunden bei der notwendigen Senkung ihrer Fertigungskosten unterstützen“, erklärt Dr. Christian Peter, Vice President Sales der RENA Technologies GmbH. „Das Aufkommen der Mono- und insbesondere der p-Typ-PERC-Technologie macht eine kostengünstige Lösung für den Texturierungsprozess erforderlich. Wir haben uns verpflichtet, eine ständige Verbesserung unserer Prozesse und Ausrüstung zu erreichen und geben diese Vorteile an unsere Kunden weiter. RENA kennt die Anforderungen in Bezug auf Kosteneinsparungen bei der Herstellung von Solarzellen, und wir freuen uns, dass wir jetzt eine neuartige und kostengünstige Lösung für die alkalische Texturierung auf den Markt bringen können.“



Alkalisch texturierte Oberfläche von monokristallinem Silizium („Zufallspyramiden“) unter Verwendung der monoTEX®-Prozesstechnologie von RENA



RENA BatchTex N400-8000:  
Neueste Generation der dem Industriestandard entsprechenden Texturierungsanlage mit einem 30 % höheren Durchsatz → bis zu 8000 Wafer/Stunde mit nur einer Maschine